

天仁微纳



设备简介

GL P2 CLIV是天仁微纳新型面板级全幅高精度紫外纳米压印设备，标配天仁微纳CLIV (Contact Litho into Vacuum) 压印技术，可在G2面板 (370x470mm) 上实现高精度 (优于10nm*)、高深宽比 (优于10:1*) 纳米结构复制。该设备支持自动复制柔性复合工作模具，工作模具具有精度高、寿命长等特点，可以显著降低大面积纳米压印工艺中模具使用成本。CLIV技术的应用保证了压印结构的精度与高深宽比结构的完整填充，同时保证了大面积结构压印均匀性。GL P2 CLIV纳米压印设备适用于DOE、AR/VR衍射光波导 (包括斜齿光栅)、线光栅偏振、超透镜、生物芯片、LED、微透镜阵列、裸眼3D等应用领域的研发和量产。

GL P2 CLIV

面板级纳米压印光刻设备 2代线 (370x470mm) 高精度紫外纳米压印光刻设备

设备参数

兼容基底尺寸	200mm&300mm晶圆、300x300mm、 370x470mm 特殊尺寸可定制
支持基底材料	硅片、玻璃、石英、塑料、金属等
上下片方式	单片机械手自动上下片
纳米压印技术	紫外纳米压印 (UV-NIL), CLIV技术, 适合高精度、 高深宽比纳米结构压印
压印精度	优于10纳米*
结构深宽比	优于10比1*
残余层控制	小于10nm*
紫外固化光源	紫外LED (365nm) 线光源, 光强>2000mW/cm ² , 水冷冷却 (面光源以及掩模区域曝光功能可选配)
设备内部环境控制	标配, 外部环境Class 100, 内部环境可达Class 10*
自动压印	支持
自动脱模	支持
自动工作模具复制	支持
自动工作模具更换	支持

*参数取决于模具、材料、工艺和使用环境，非设备极限
*天仁微纳保留对信息的解释权

主要功能

- 2代线面板级高精度、高深宽比结构纳米压印设备;
- CLIV技术, 确保压印结构精度与填充完整性;
- 设备内自动复制柔性复合工作模具, 降低大面积纳米压印模具使用成本;
- 工作模具自动更换, 适合连续生产;
- 自动压印、自动曝光固化、自动脱模, 工艺过程无需人工干预;
- 标配高功率紫外LED线光源 (365nm, 光强>2000mW/cm²), 水冷冷却, 掩模区域曝光功能、面光源、特殊功率以及特殊、混合波长光源可订制, 完美支持各种商用纳米压印材料与制程;
- 标配设备内部洁净环境与除静电装置;
- 随机提供全套纳米压印工艺与材料, 包括DOE、AR斜齿光栅、高密度、高深宽比结构以及微透镜阵列、柱状透镜阵列等工艺流程, 帮助客户零门槛达到国际领先的纳米压印水平。

OUR 
CONTACT!

联系方式
青岛天仁微纳科技有限责任公司
青岛市城阳区祥阳路106号 青岛未来科技产业园6号楼
电话: 0532-67769322
传真: 0532-67768286
电子邮件: contact@germanlitho.com
网址: www.germanlitho.com

Qingdao GermanLitho Co., Ltd.
Building 6, No.106 Xiangyang Rd.,
Chengyang District Qingdao Future
Science and Technology Industrial
Park, China
Tel: 0532-67769322
Fax: 0532-67768286
E-mail: contact@germanlitho.com
Web: www.germanlitho.com